

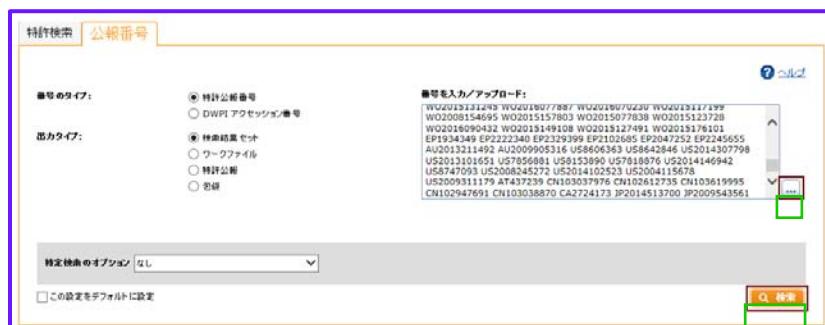
貴社特許ポートフォリオでのライセンスの機会を特定する

自社の特許ポートフォリオの価値はどこにあるのか？保護が未対応の事項はないか？ライセンシング、訴訟、販売の候補となるものはあるか？

Derwent Innovation は、貴社の特許ポートフォリオの価値を最大限に有効活用するのに役立ちます。DI 上のツールを使用し素早く引用分析を実行することで、ライセンシング機会の特定に活かします。

ステップ 1 - 特許のポートフォリオを追加し、引用の多い特許を特定する

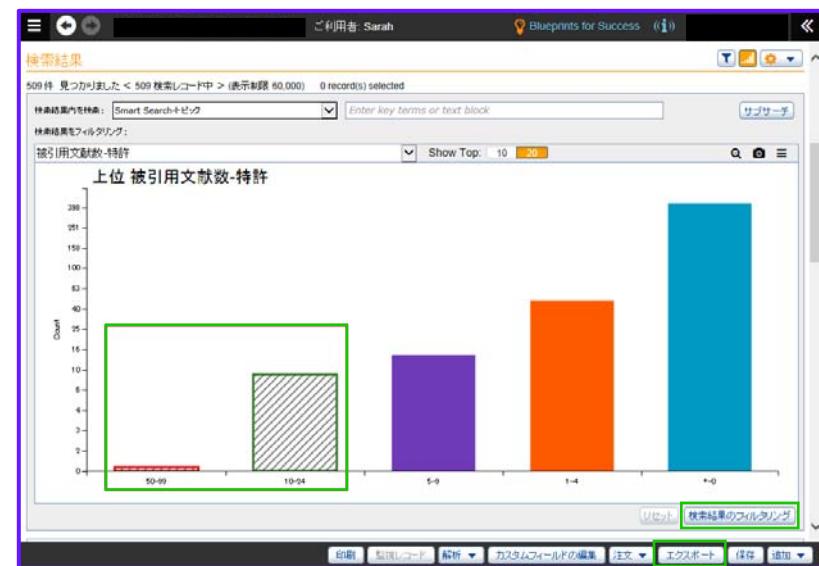
特許ポートフォリオを追加する



- ライセンシング用に分析し、テキストファイルとして保存したい特許公報番号のリストを入手します
- Derwent Innovation を開き、**特許タイル**をクリックします。次に、**【公報番号】**タブをクリックします
- …ボタンをクリックしてリストをアップロードし、**【検索】**をクリックします

注記 : Derwent Innovation は、入力された公報番号を検証します。無効な番号が検出されると、問題を修正するためのウィンドウが開きます。

引用の多い特許を特定



検索を実行すると表示される検索結果ダッシュボードを使用することで、ポートフォリオで引用の多い特許のリストをエクスポートできます。

- 【被引用文献数-特許】** の図表を選択し、**拡大**アイコンをクリックして拡大します
- 上位 2 件の引用のバーまたはバブルを選択して、**【検索結果のフィルタリング】** をクリックします
- 【エクスポート】** ボタンをクリックして引用の多い特許のリストを作成し、ThemeScape マップ上で表示します
- 【フォーマット】** メニューをクリックして、**【Excel 2007】** を選択します
- 【選択可能なフィールド】** の下で、**【要約】** フィールドセットを選択し、右矢印をクリックして、**【作成】**をクリックします
- エクスポート ファイルを開くために表示されている **【注文状況】** 画面で **【ダウンロード可】** リンクをクリックし、Excel シートを開きます

ステップ 2 - 引用の多い技術カテゴリーを見つける

さまざまな技術分野で、非常に多く引用される特許を多数所持している場合 ThemeScape は、技術分野別に貴社のポートフォリオを素早く分類することができ、ライセンス付与分析に専念することができます。

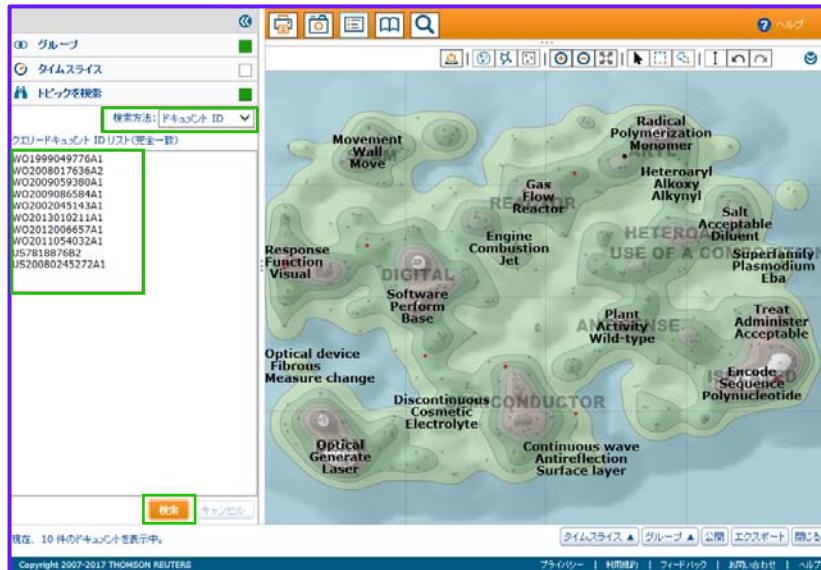
ThemeScape マップを作成する



1. [リセット] ボタンをクリックしてフィルターを消去し、元の検索結果に戻ります
2. [解析]、[ThemeScape] をクリックします
3. マップの名前を入力し、[保存] をクリックします
4. マップが処理されるのを待ち、 アイコンをクリックして開きます

注記 : ThemeScape マップはバックグラウンドで処理されるので、マップのプロセス中にも Derwent Innovation での作業を継続できます。

引用の多い特許を特定

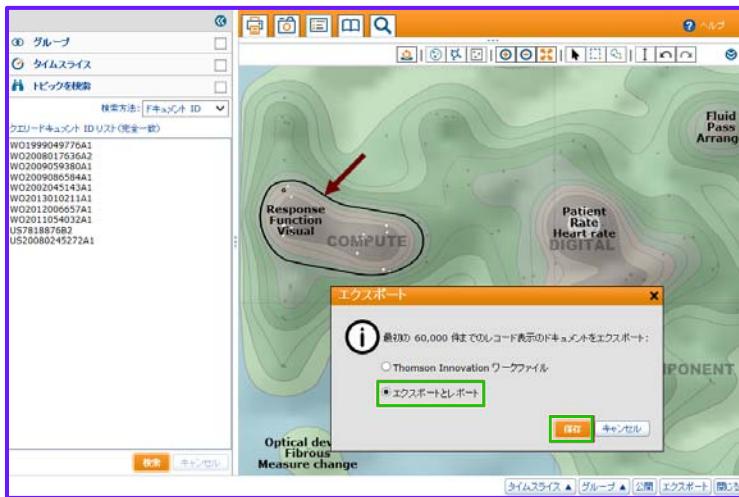


最も引用の多い技術カテゴリーを表示するには、ThemeScape マップと引用の多い特許のリストを使用します。これによりライセンシングの機会が分かります。

1. [トピックを検索] パネルを開き [検索方法] メニューで [ドキュメント ID] を選択します
2. 作成したエクスポートファイルの引用の多い公報番号をボックスに貼り付け、[検索] をクリックします
3. 自動的に作成される新グループの名前を入力し、[保存] をクリックします

上記の手順により、引用の多い特許がマップ上に色付きの点で表示されます。

詳細な分析のために技術カテゴリーをエクスポート

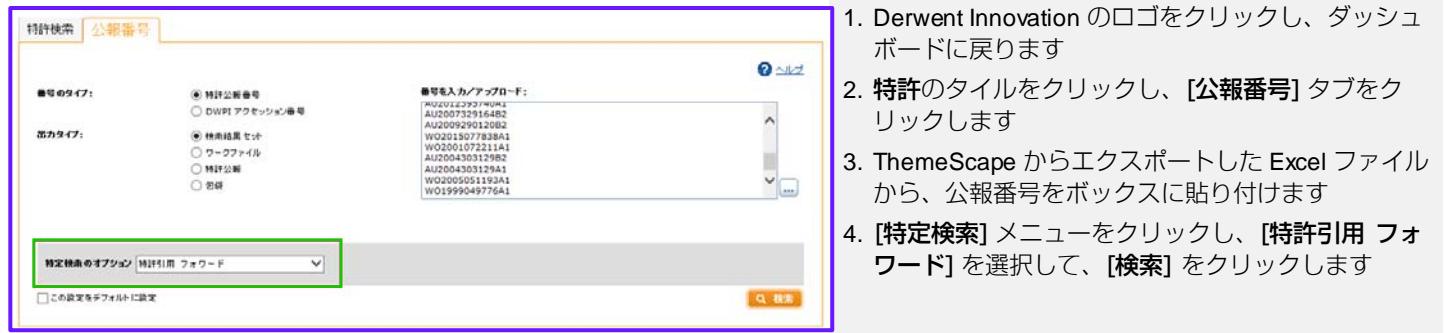


ThemeScape マップのピークは技術カテゴリーを示します。これらの点を使用することで、最も引用の多かったカテゴリーを調べ、さらに詳細な分析のためにカテゴリーをエクスポートすることができます。

1. 分析したい技術カテゴリーにズームインし、そのカテゴリーの等高線をクリックします
2. [エクスポート] をクリックし、[エクスポートとレポート] を選択します
3. [フォーマット] メニューをクリックし、[Excel 2007] を選択して [作成] をクリックします
4. ThemeScape マップのウィンドウを最小化します
[注文状況] 画面で [ダウンロード可] リンクをクリックし、Excel シートを開きます

ステップ 3 - 技術カテゴリーで潜在的にライセンシングが可能な特許を見つける

フォワード サイテーション検索を実行する



ヒント: DWPI を使用するユーザーは、DPCI 特許引用フォワードを選択できます。これは発明レベルで引用を検索し、DWPI ファミリー全体の被引用特許を見つけます。

最も引用した譲受人を特定

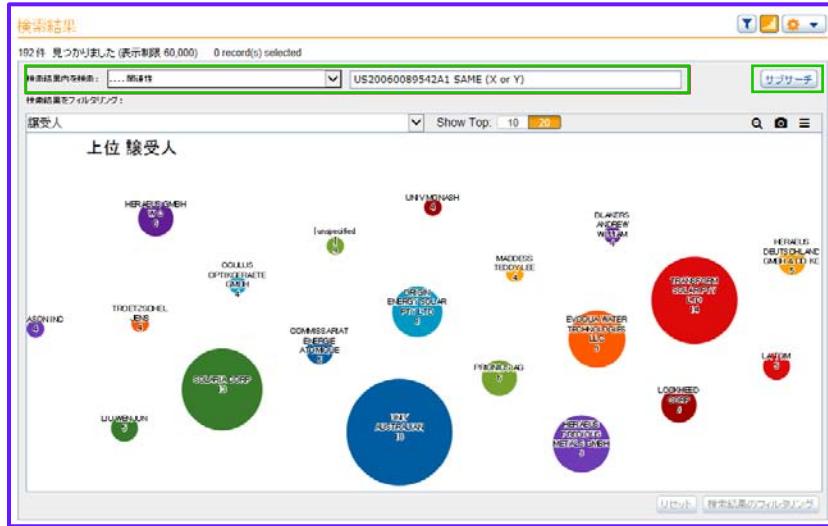


譲受人の図表を選択して アイコンで拡大し、どの譲受人が最も頻繁にそのポートフォリオを引用しているかを確認します。このデータ内では、次の点に着目します。

- ポートフォリオ オーナーは一般的に主要な引用元（自己引用）であり、投資、ポートフォリオの構築や、防衛的特許などが示されていることがあります
- 他の譲受人によって行われた引用からは、競合他社/侵害のリスクとして監視すべき、潜在的なライセンス譲受人や企業が明らかになることがあります
- 特定の譲受人を選択して、[フィルタリング] をクリックし、それらの譲受人による被引用特許を確認します

特定の特許に対する逆の引用（類似した技術）をもつ譲受人を特定

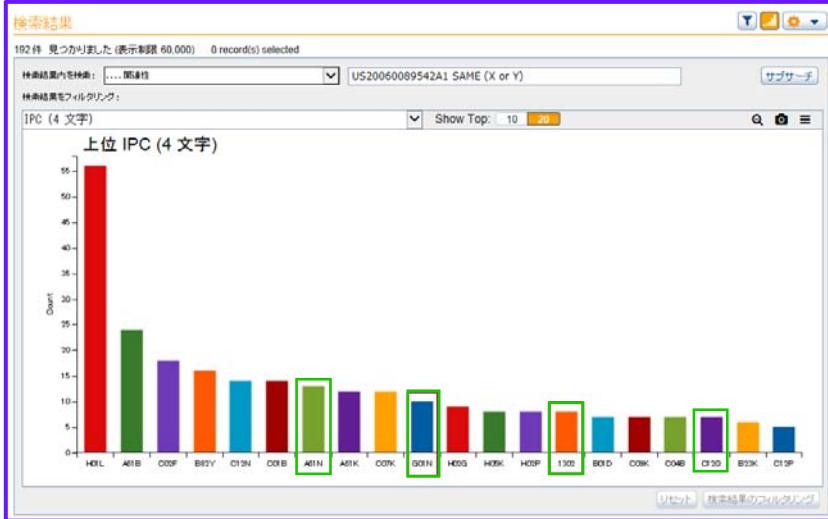
EP および PCT 特許の引用審査官は、参照する理由を含めた先行技術の調査報告を提出します。参照タイプ X と Y は「新規性なし」または「明白な」特許を示し、これらには類似した先行技術が提示されます。



これらの参照タイプに分類される、貴社のポートフォリオの特許を引用する譲受人は、主要なライセンス付候補者といえます。

1. [検索結果内を検索] メニューをクリックし、[関連性カテゴリー] を選択します
2. ポートフォリオに属する特許番号、SAME、および (X OR Y) と入力します
例: US20060089542A1 SAME (X or Y)
3. [サバサーチ] をクリックして表示された譲受人を確認し、逆の引用が存在する特許を引用している法人を確認します
4. [戻る] ボタンをクリックして、特定検索結果に戻ります
5. この区分に含まれる引用の多い貴社の特許すべてについて、同じ処理を繰り返します

新しい技術分野での傾向を見つける



IPC-4 文字コードは、特許を大分類レベルで説明しています。これらのコードの説明を使用して、貴社のポートフォリオを引用している特許を確認することができます。当該の技術分野にそぐわないように見える記述がきっかけで、特許にとっての基礎となる技術の新たな用途を見いだせる可能性もあります。

1. IPC-4 文字の表示を選択し、 アイコンをクリックして拡大します
2. 各データ ポイントの上にマウス ポインターを置き、各コードの定義を確認します
3. 説明から技術分野に含まれないとと思われるコードを選択し、[フィルタリング] をクリックして、潜在的な新しい出願の機会がある特許を表示します

下流に影響のある被引用特許を見つける



被引用文献数-特許	件数
100-99	1
50-99	2
25-49	4
10-24	25
5-9	15
1-4	45
0-0	80

ポートフォリオで特許を引用する特許には、それぞれ被引用文献を持つ場合があります。これには、核となる発明の外部へのライセンス付与の機会があるかもしれませんことを示しています。

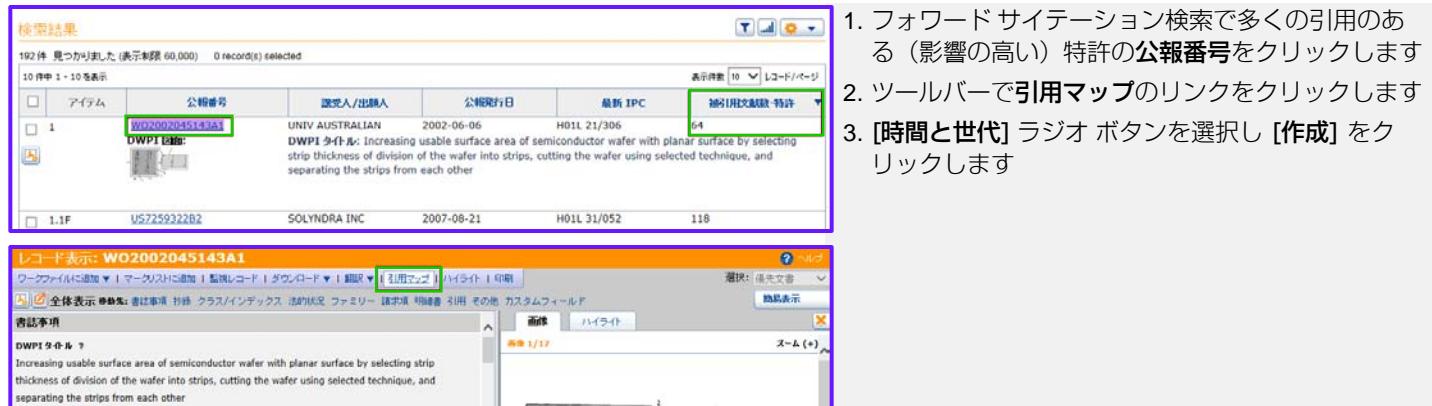
1. [被引用文献数-特許] の図表を選択し、アイコンをクリックして拡大します
2. 上位 2 件、3 件の引用範囲のバーまたはバブルを選択して、[検索結果のフィルタリング] をクリックします
3. 検索結果ダッシュボードを使用して上位の被引用特許を確認し、その所有者や特許の技術領域を確認することによりライセンス付与の機会を特定します
4. 確認を終えたら [リセット] をクリックして、フォワードサイテーション検索に戻ります

ヒント: DWPI にアクセスできるユーザーが DPCI 引用検索を使用すると、[DPCI 被引用アクセション番号] を選択して、個々の特許ではなくポートフォリオに含まれる特許を引用する発明がいくつあるかを確認できます。これは影響の全体像を把握するのに有効です。

最良の検索結果を得るために、被引用特許のもたらす下流への影響を確認する前に、分析から自己引用を除きます。検索結果ダッシュボードの表示から適切な譲受人のみを選択し、[フィルタリング] をクリックします。

ステップ 4 - ライセンシングの機会に大きな影響力を有する特許を評価する

影響力をもつ特許の引用マップを作成する



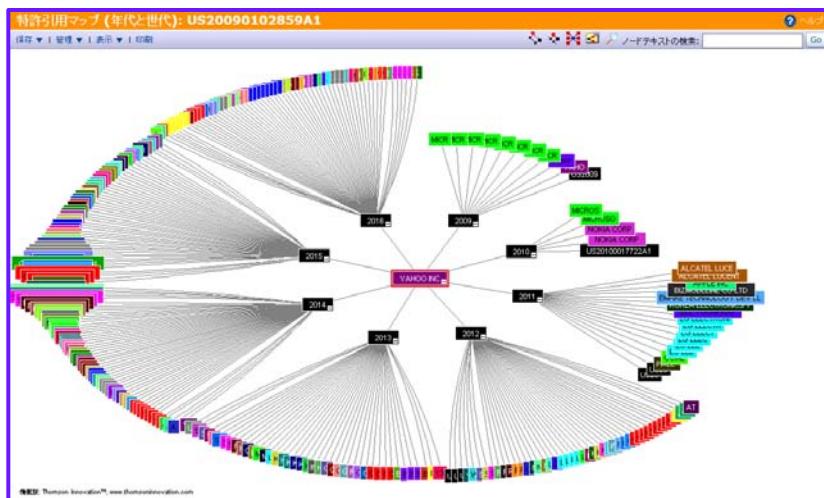
検索結果
192 件 見つかりました (表示制限 60,000) 0 record(s) selected
10 件中 1 ~ 10 件表示

アイテム	公報番号	請求人/出願人	公報発行日	最新 IPC	被引用文献数 特許
1. DWPI タイプ: WO2002045143A1	WO2002045143A1	UNIV AUSTRALIAN	2002-06-06	H01L 21/306	64
1.1F	US7259322B2	SOLYNDRA INC	2007-08-21	H01L 31/052	118

レコード表示: WO2002045143A1
ワークファイルに追加 ▾ | マークストリーム | 複数コード | ダウンロード ▾ | 開く ▾ | [引用マップ] | ノード | 印刷
全体表示: 申請: 未審査 未決: 未審査 クラス/インデックス: 法的状況 ファミリー: 請求項: 专利者: 引用: その他 カスタムフィールド
書誌事項
DWPI タイプ: 9
Increasing usable surface area of semiconductor wafer with planar surface by selecting strip thickness of division of the wafer into strips, cutting the wafer using selected technique, and separating the strips from each other

ヒント:  アイコンをクリックし、[表示と並び替えのオプション] を選択して、検索結果リストに引用回数フィールドを追加します。全ユーザーが [被引用文献数 特許] にアクセスでき、何件の特許が検索結果にあるそれぞれの特許を引用しているかが表示されます。DWPI 検索を使用している場合は、代わりに、DPCI の被引用特許数を追加することができます。また、ある特許を引用する発明の件数を見ることのできる被引用アクセス番号数や、被引用特許発行機関数を追加することもできます。

市場トレンドとライセンス機会について、引用マップを調査する



特許引用マップ (年代と世代): US20090102859A1
ノードテキストの検索: Go

引用マップを調査することで、市場とライセンシングの機会を確認できます。

- [表示] をクリックして、[ノードの並べ替え] と [ノードの色分け] を [譲受人] に設定することで、この領域の特許関連組織が継続的にどのように変化したかを確認できます
- 引用特許の動向を探る: 継続的に減少したか、増加したかを検討することで、分野の有効性を判断できます
- この特許をよく引用する早期イノベーターは、ライセンシングの候補者となることがあります
- 新興の、潜在的に混乱を引き起こす可能性のある企業は、ライセンスの付与や潜在的な訴訟対象の候補となることがあります

注記: 引用マップは Google Chrome ではサポートされていません。

これらのヒント (英語) によってさらに詳しく学ぶ

- [Identifying Highly Relevant, Examiner Added Citations In A Citation Map](#)
- [Sorting The Result Set By Relevancy Or Count Of Citing Patents](#)
- [Portfolio Wide Analysis Of Citations](#)
- [Who Is Citing Your Patents?](#)